

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

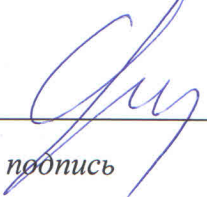
по диссертационной работе *Бикчуриной Марины Игоревны* на тему «*Исследование генерирующих свойств литиевой мишени*», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника

№		
1	Фамилия Имя Отчество	Окс Ефим Михайлович
2	Ученая степень, шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация	Доктор технических наук, 05.27.02 – Вакуумная и плазменная электроника
3	Ученое звание	профессор
4	Академическое звание	нет
Место основной работы:		
5	Полное название организации	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
6	Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
7	Тип организации	Федеральное государственное автономное учреждение
8	Занимаемая должность, подразделение	Заведующий лабораторией плазменной электроники /заведующий кафедрой физики
9	Почтовый индекс, адрес	634050, г. Томск, пр. Ленина, 40
10	Телефон	(3822) 41-47-12
11	Адрес электронной почты	oks@fet.tusur.ru
<p>Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implantation of tantalum ions into a dielectric coating synthesized by electron-beam evaporation of aluminum oxide ceramic in the forevacuum pressure range / K. Savkin, E. Oks, V. Semin, A. Tyunkov [et al.]. – Текст : электронный // Vacuum. – Vol. 217. – 2023. – 112593. – URL: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112593 – Дата обращения: 05.10.2023. 2. Operation features of a forevacuum pulsed plasma-cathode broad-beam electron source with a double-mesh emission electrode / A. Kazakov, E. Oks, N. Panchenko. – Текст : электронный // Vacuum. – Vol. 213. – 2023. – 112129. – URL: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112129 – Дата обращения: 05.10.2023. 3. Experiment and simulation of generation of highly charged ions in a pulsed vacuum arc / V. Frolova, A. Nikolaev, E. Oks, V. Oreshkin [et al.]. – Текст : электронный // Vacuum. – Vol. 213 – 2023. – 112062. – URL: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112062 – Дата обращения: 05.10.2023. 		

4. Electron-beam heating of ceramics to moderate temperature at fore-vacuum pressure / D. Zolotukhin, E. Oks, A. Tyunkov, Yu. Yushkov. – Текст : электронный // Radiation Physics and Chemistry. – Vol. 197. – 2022. – 110169. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2022.110169> – Дата обращения: 05.10.2023.
5. Effects of gas pressure and bias potential on electron beam nitriding of titanium / A. Tyunkov, E. Oks, Yu. Yushkov [et al.]. – Текст : электронный // Journal of Applied Physics. – Vol. 131, nr 21. – 2022. – 213302. – URL: <https://doi.org/10.1063/5.0089782> – Дата обращения: 05.10.2023.
6. Influence of electron beam generation on the parameters and emission characteristics of a constricted arc discharge in a pulsed forevacuum plasma-cathode electron source / A. Kazakov, E. Oks, N. Panchenko. . – Текст : электронный // Vacuum. – Vol. 200. – 2022. – 110990. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.110990> – Дата обращения: 05.10.2023.
7. Electron beam synthesis of silicon-carbon coatings in the forevacuum pressure range / D. Zolotuhin, A. Kazakov, E. Oks [et al.]. – Текст : электронный // Vacuum. – Vol. 48, nr 10. – 2022. – P. 13890-13894. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.110990> – Дата обращения: 05.10.2023.
8. Physical Features of the Functioning of a Planar Magnetron Sputter with a Thermally Insulated, Discharge-Heated Target for Boron Coating Deposition / A. Vizir, A. Nikolaev, E. Oks [et al.]. – Текст : электронный // Russian Physics Journal. – Vol. 64, nr 12. – 2022. – P. 2177-13894. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.110990> – Дата публикации: 01.04.2022.
9. Ion beam composition in ion source based on magnetron sputtering discharge at extremely low working pressure / A. Vizir, A. Bugaev, V. Frolova [et al.]. – Текст : электронный // Review of Scientific Instruments. – Vol. 93, nr 4. – 2022. – 043304. – URL: <https://doi.org/10.1063/5.0086224> – Дата публикации: 01.04.2022.
10. Magnetron sputtering and electron beam evaporation systems for pure boron thin film coatings / A. Nikolaev, E. Oks, A. Tyunkov [et al.]. – Текст : электронный // Journal of Physics: Conference Series. – Vol. 2291, nr 1. – 2022. – 012026. – URL: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2291/1/012026> – Дата обращения: 05.10.2023.
11. Dielectric Coating Deposition Regimes during Electron-Beam Evaporation of Ceramics in the Fore-Vacuum Pressure Range / Yu. Yushkov, E. Oks, A. Tyunkov, D. Zolotukhin [et al.]. – Текст : электронный // Coatings. – Vol. 12, nr 2. – 2022. – 130. – URL: <https://doi.org/10.3390/coatings12020130> – Дата публикации: 01.02.2022.
12. Deposition of tungsten disilicide films by DC magnetron sputtering at ultra-low operating pressure / M. Shadrikov, A. Bugaev, V. Gushenets [et al.]. – Текст : электронный // Surface and Coatings Technology. – Vol. 422. – 2021. – 127501. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127501> – Дата публикации: 25.09.2021.
13. Influence of the aluminum ion implantation dose on the phase composition of submicrocrystalline titanium / A. Nikonenko, N. Popova, E. Nikonenko [et al.]. – Текст : электронный // Vacuum. – Vol. 189. – 2021. – 110230. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2021.1102301> – Дата публикации: 01.07.2021.
14. Electron-beam deposition of aluminum nitride and oxide ceramic coatings for microelectronic devices / Yu. Yushkov, E. Oks, A. Tyunkov [et al.]. – Текст : электронный // Coatings. – Vol. 11, nr 6. – 2021. – 645. – URL: <https://doi.org/10.3390/coatings11060645> – Дата публикации: 01.07.2021.
15. Surface modification by beams and plasma flows of boron ions generated by vacuum arc sources / A. Bugaev, V. Gushenets, E. Oks [et al.]. – Текст : электронный //

Proceedings - 2020 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects, EFRE 2020 (Томск, Россия, 14-26 сентября 2020). – Томск, 2020. – Р. 634-638. – URL: <https://doi.org/10.1109/EFRE47760.2020.9241918> – Дата публикации: 14.10.2021.

Я, Окс Ефим Михайлович, согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело соискателя и их дальнейшую обработку.


_____/Е.М. Окс/
подпись

Подпись Е.М. Окса удостоверяю.

Ученый секретарь совета ТУСУР  / Е.В. Прокопчук/
подпись, печать

«24» июля 2024 г.

